

海外企業との取引の基礎

～展示会・商談会での情報流出・技術盗用を防ぐ～

海外企業へ技術・製品を売り込む際、営業秘密や特許等知的財産権に関する知識・対策が不十分であると、技術の情報流出、盗用につながる恐れがあります。

ジェトロでは、展示会出展や海外企業との商談にあたり、必ず行わなければならない情報流出・技術盗用対策についてセミナーを開催します。内容は基礎的なものとなりますので、海外企業との取引を今後始められる方は是非ご参加下さい。

開催日時 : 2011年1月24日(月) 14:00～16:00

会場 : ジェトロ本部 5階 ABCD 会議室

対象 : 海外企業との取引を目指すナノテク等ハイテク分野の中小・ベンチャー企業

主催 : ジェトロ

定員 : 100名(先着順)

お申込 : <http://www.jetro.go.jp/events/nanoseminar>

『海外企業との取引の基礎～展示会・商談会での情報流出・技術盗用を防ぐ～』

14:00～15:45

(質疑応答 15分)

展示会、商談会の際の情報流出・技術盗用対策の基礎として、「特許と営業秘密の仕分け」、「出品物および開示する情報の選択」、「契約の際の注意点」等について日本企業が陥りやすい事例とあわせ、ご紹介します。

(講師) 服部 正明 / ジェトロ知的財産課アドバイザー



1968年		早稲田大学理工学部機械工学科卒業
同年	4月	本田技研工業(株)
同年	5月	(株)本田技術研究所配属
1983年		同 主任研究員
1994年		同 特許・技術情報課 課長
2001年		本田技研工業(株) 知的財産部 主幹
2005年	8月	本田技研退職
同年	9月～	ジェトロ知的財産課アドバイザー

本田技研では模倣品対策の担当主幹として、中国のみならず世界各国での模倣品対策に従事。業界団体活動として、(社)日本自動車工業会の知的財産 WG 主査として、2002年～2005年にかけて中国を中心とした数々の知財問題対策プロジェクトに従事。2005年9月からはジェトロアドバイザーとして、数多くの中小企業等からの知財に関する相談に幅広く対応する他、各地で開催の模倣対策セミナーでも多数講演を行う。

『中小企業サポートのご案内』

15:45～16:00

一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会(NBCI)より、中小企業サポートについてご案内します。